

# 2008年3月期決算説明会

2008年5月14日

株式会社ホロン

JQ7748

Solutions for Mask & Wafer Metrology

# INDEX

1. 2008年3月期決算の概要
2. 2009年3月期の業績見通し
3. 基本方針と経営戦略  
～ニュー・ホロンの創生～

# 1. 2008年3月期決算の概要

# 当期損益(対予想比)

(単位:百万円)

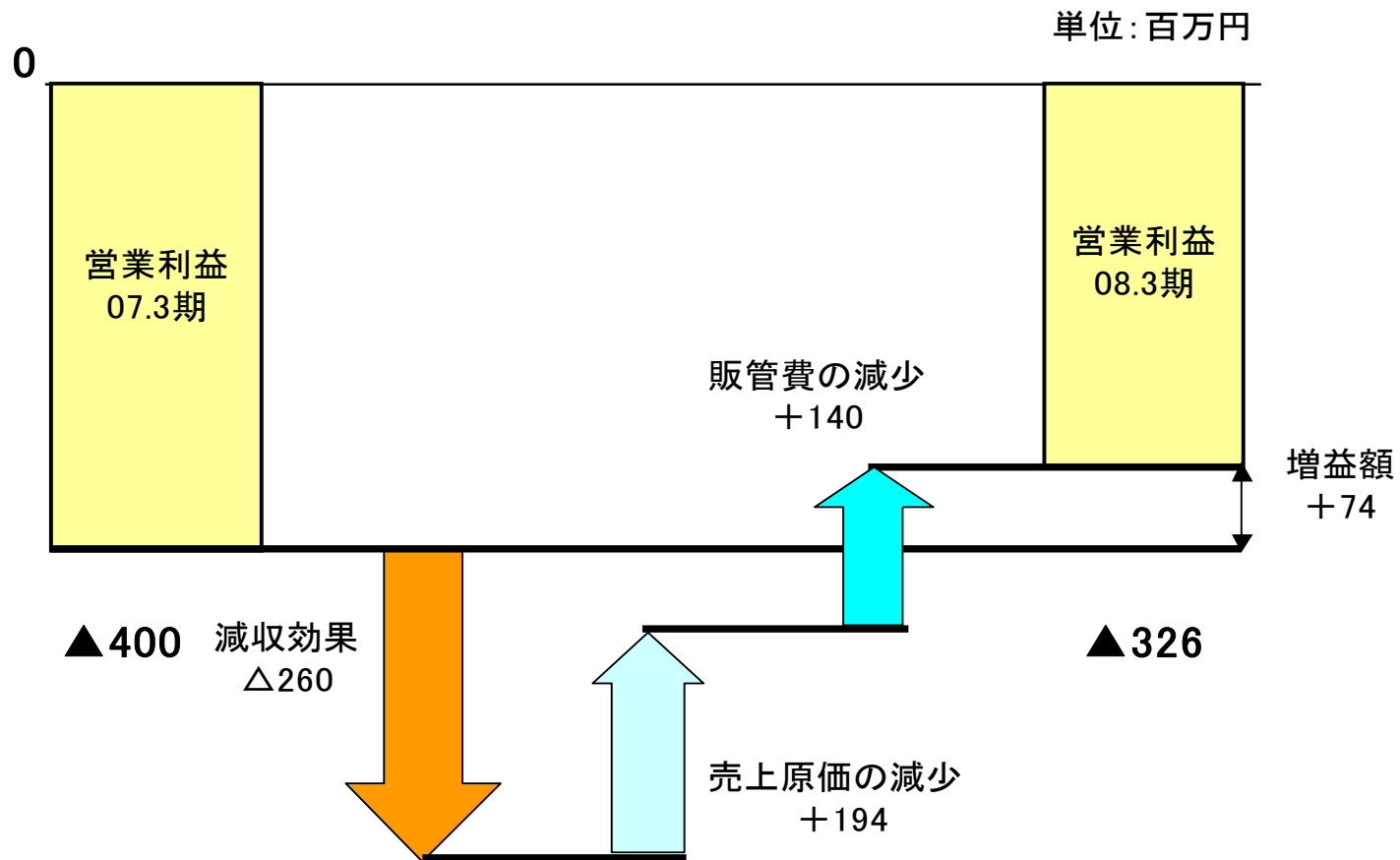
|       | *修正後  | 08年3月期 | 対予想比 |        |
|-------|-------|--------|------|--------|
|       | 予想値   | 実績     | 増減額  | 増減比(%) |
| 売上高   | 300   | 306    | 6    | 2.0%   |
| 営業利益  | △ 318 | △ 326  | △ 8  | —      |
| 経常利益  | △ 318 | △ 343  | △ 25 | —      |
| 当期純利益 | △ 378 | △ 409  | △ 31 | —      |

# 当期損益(対前期比)

(単位:百万円)

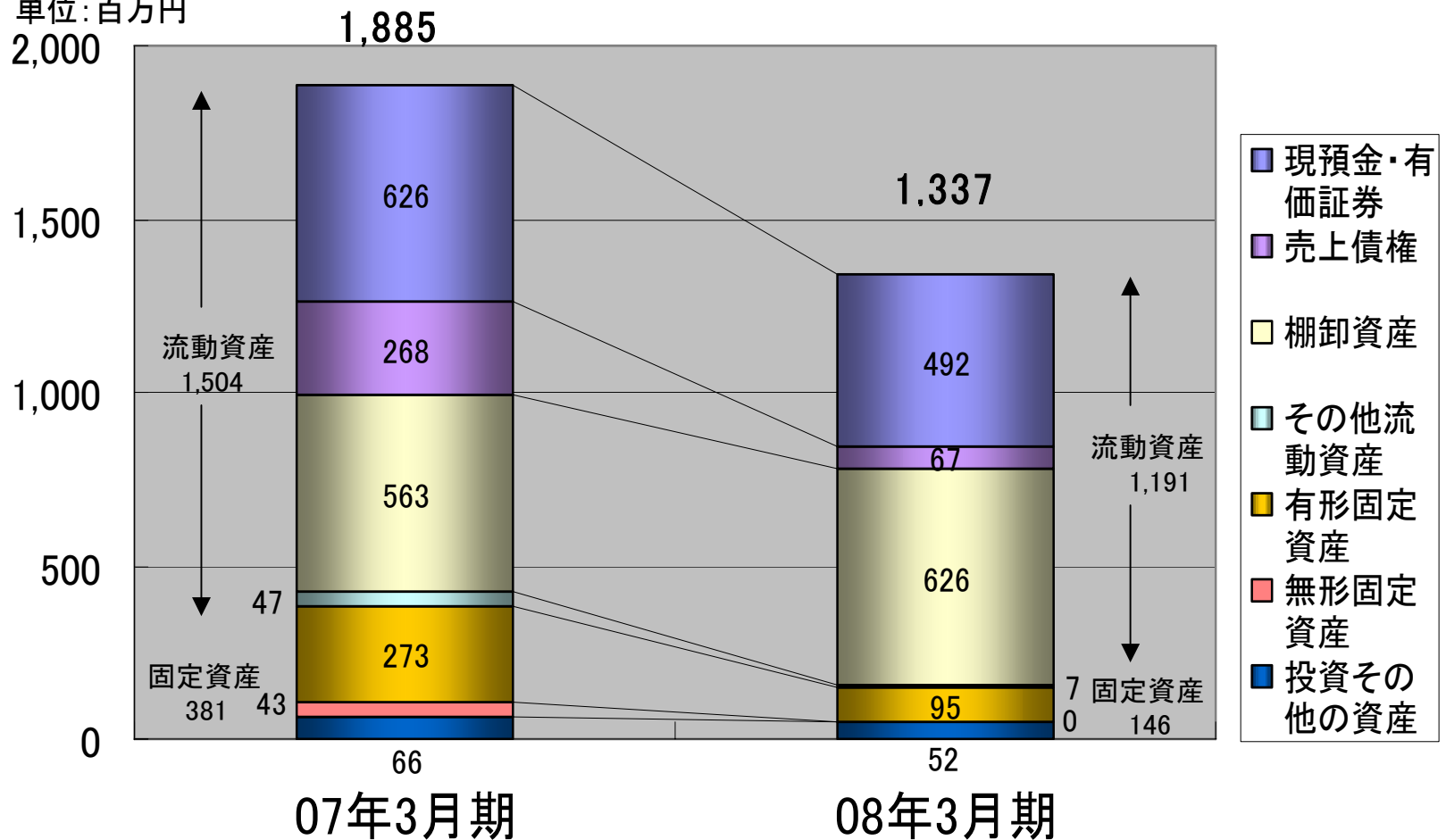
|            | 07/3期 |            | 08/3期 |            | 対前期比  |            |
|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
|            | 金額    | 百分比<br>(%) | 金額    | 百分比<br>(%) | 増減額   | 増減比<br>(%) |
| 売上高        | 566   | 100.0%     | 306   | 100.0%     | △ 260 | △ 46.0%    |
| 売上総利益      | 180   | 31.9%      | 115   | 37.6%      | △ 65  | △ 36.5%    |
| 販管費及び一般管理費 | 581   | 102.6%     | 441   | 144.3%     | △ 140 | △ 24.1%    |
| 営業利益       | △ 400 | △ 70.7%    | △ 326 | △ 106.7%   | 74    | —          |
| 経常利益       | △ 396 | △ 69.9%    | △ 343 | △ 112.2%   | 52    | —          |
| 当期純利益      | △ 398 | △ 70.3%    | △ 409 | △ 133.9%   | △ 11  | —          |

# 当期営業利益 対前期比増減要因



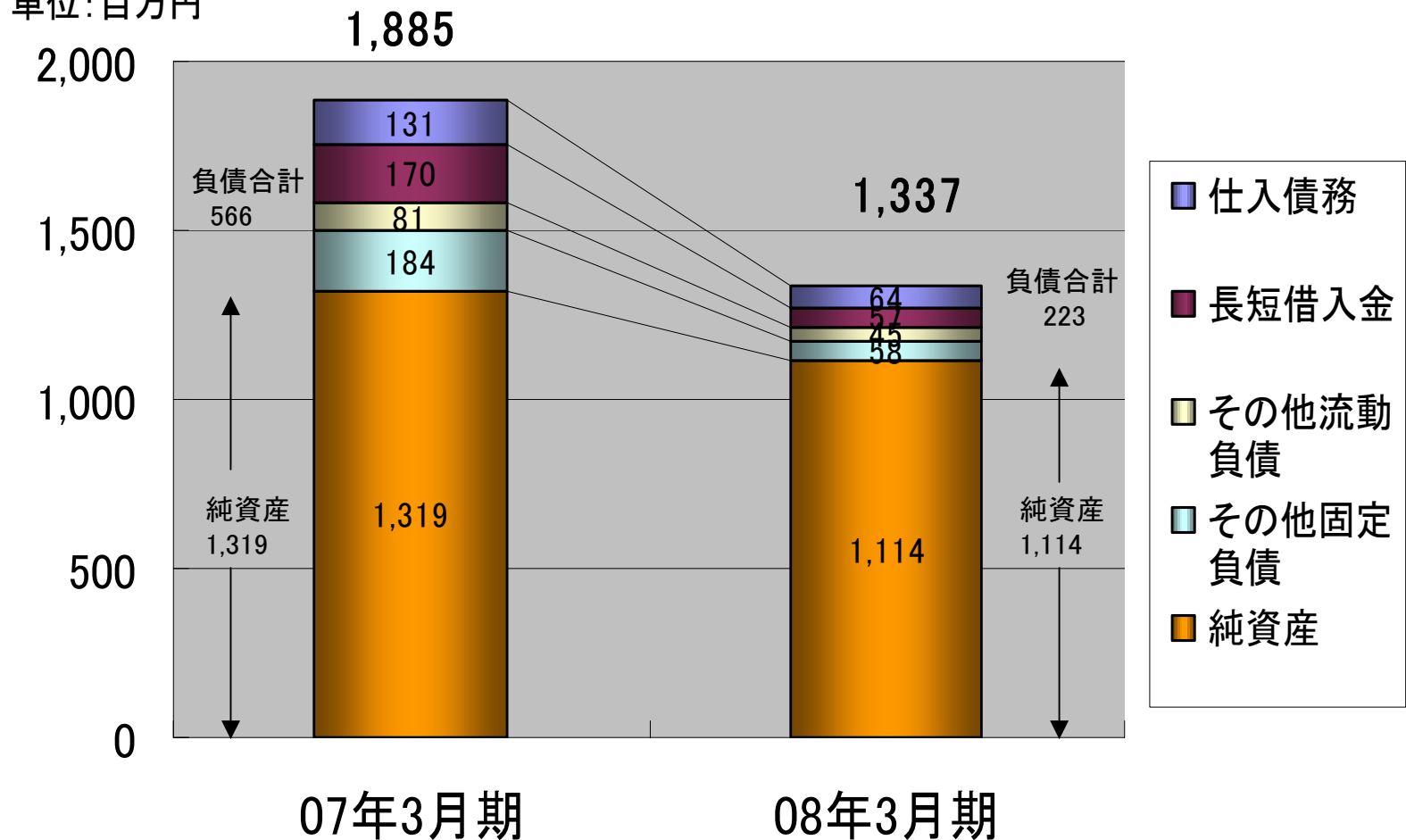
# 資産の状況

単位:百万円  
2,000



# 負債・資本の状況

単位: 百万円



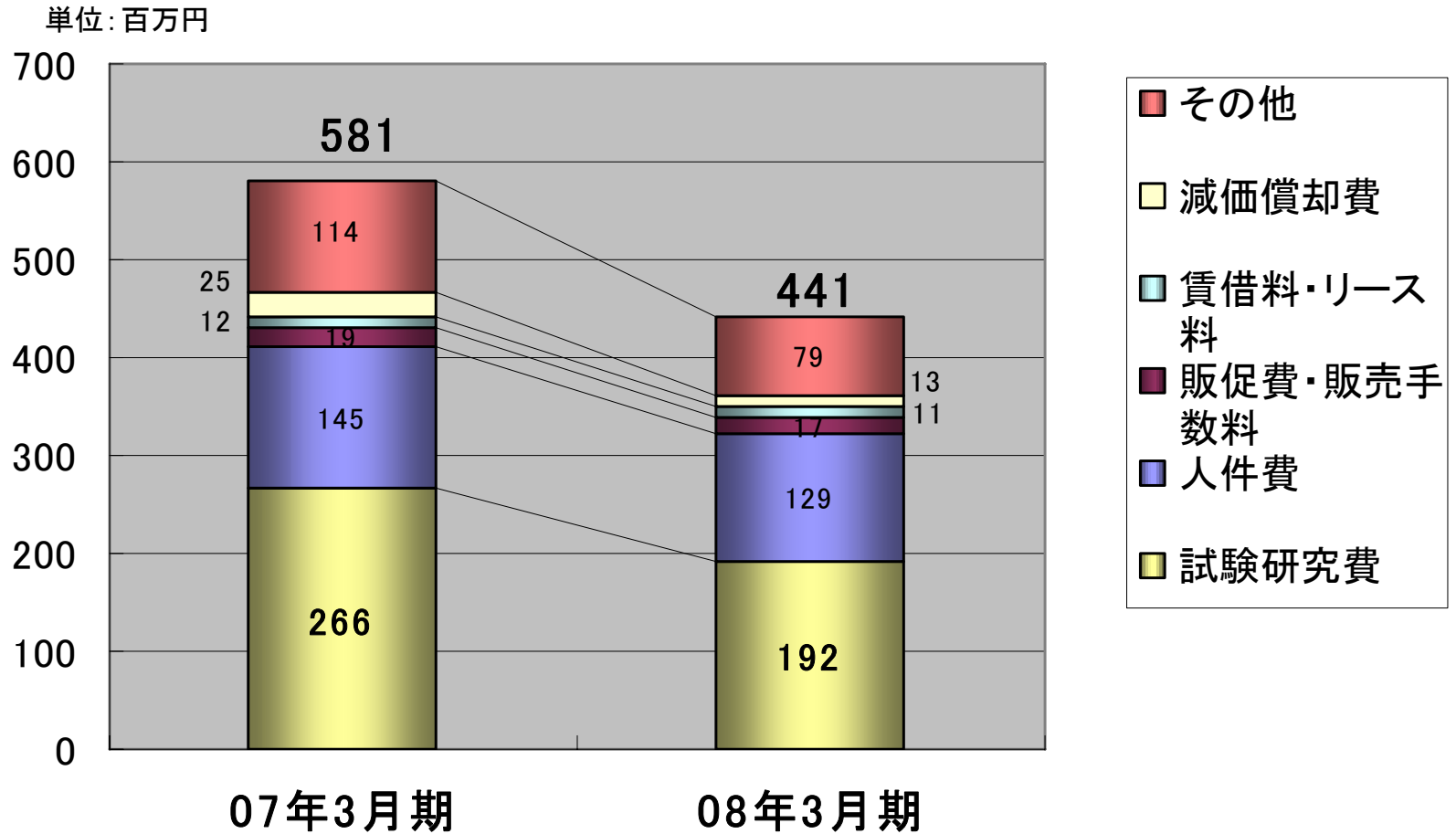


# キャッシュフローの状況

(単位:百万円)

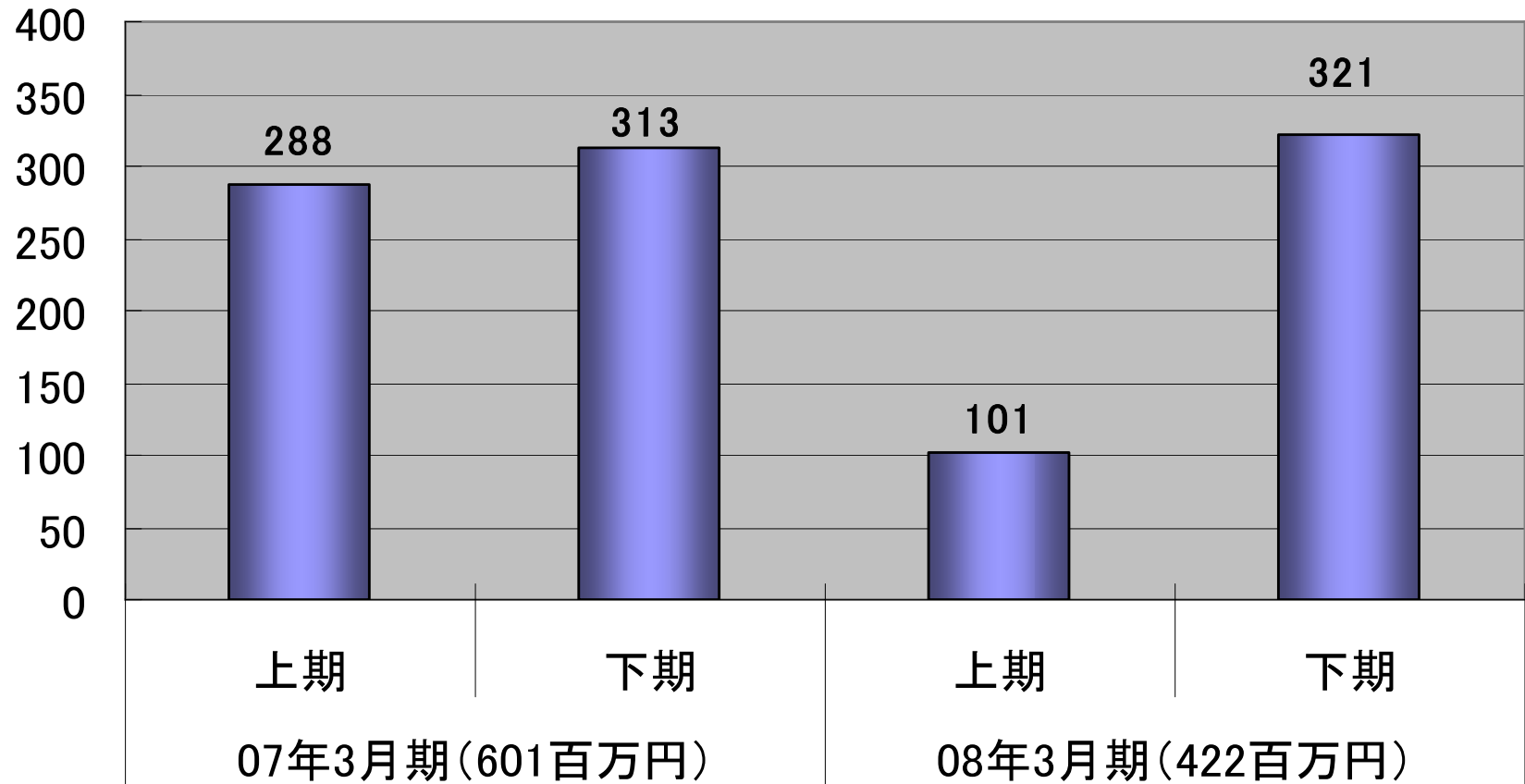
|                  | 07年3月期 | 08年3月期 | 増減    |
|------------------|--------|--------|-------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ 452  | △ 206  | 246   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 79   | △ 10   | 68    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7      | 90     | 82    |
| 現金及び現金同等物の増加額    | △ 523  | △ 134  | 388   |
| 現金及び現金同等物の期末残高   | 625    | 491    | △ 134 |

# 販管費の状況



# 受注実績の状況

単位: 百万円



## 2. 2009年3月期業績見通し

## 業績見通し

(単位:百万円)

|        | 08/3期   | 09/3期<br>予想 | 増減額 | 増減率    | 07/3期  |
|--------|---------|-------------|-----|--------|--------|
| 売上高    | 306     | 870         | 564 | 184.3% | 566    |
| 営業利益   | △ 323   | 13          | 336 | —      | △ 400  |
| (売上高比) | △105.7% | 1.5%        | —   | —      | △70.7% |
| 経常利益   | △ 332   | 14          | 346 | —      | △ 396  |
| (売上高比) | △108.7% | 1.6%        | —   | —      | △69.9% |
| 当期純利益  | △ 406   | 12          | 418 | —      | △ 398  |
| (売上高比) | △132.9% | 1.4%        | —   | —      | △70.3% |

# 3. 基本方針と経営戦略

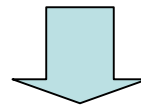
(方向と展開)  
～ニュー・ホロンの創生～

# 基本方針

スモール・カンパニーの俊敏性を活かす

「スモール・カンパニーは速く走れ」

「小さいから速い、小さいけど強い」



企画開発から製品化までのスピードアップ

スピーディなサービスと信頼を提供

# 経営戦略（～方向～）

- ①市場動向及び顧客ニーズの分析における合理性と客観性の確立
- ②主力製品における他社との技術提携強化
- ③海外営業における販売・サービス体制の明確化
- ④A & Dとの共同開発を視野に入れた関係強化



# 経営戦略（～展開～）

- ①主力製品EMUの性能アップ
- ②電子スタンパーEBLITHOのLED市場投入
- ③製品ラインアップの充実

# ①主力製品EMUの性能アップ

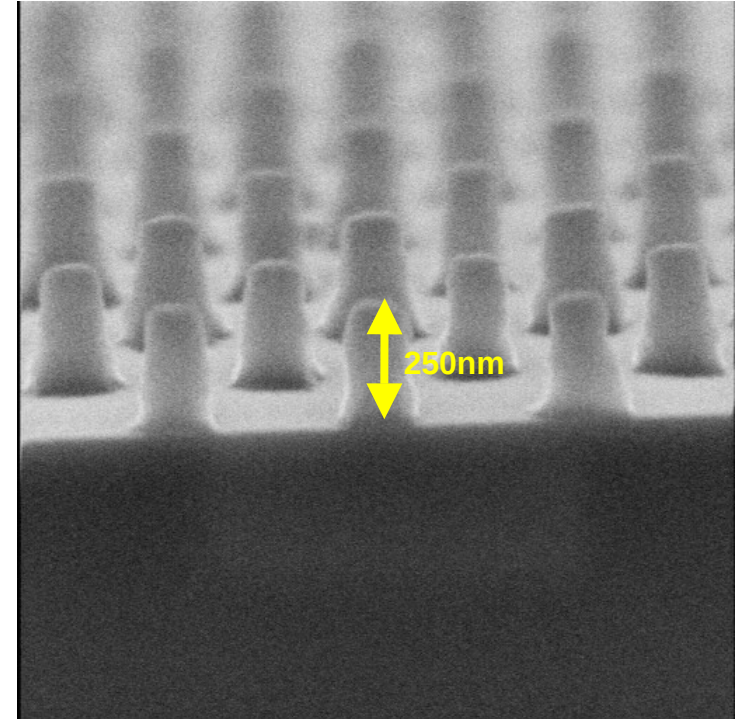
## Mask CD-SEM : EMU-270A



超微細パターンに対応するため、収差補正機能付レンズ<sup>\*1</sup>を搭載したCD-SEMを世界で初めて商品化しました。

## ②電子スタンパーEBLITHOのLED市場投入

EB-Stamper : *EBLITHO*

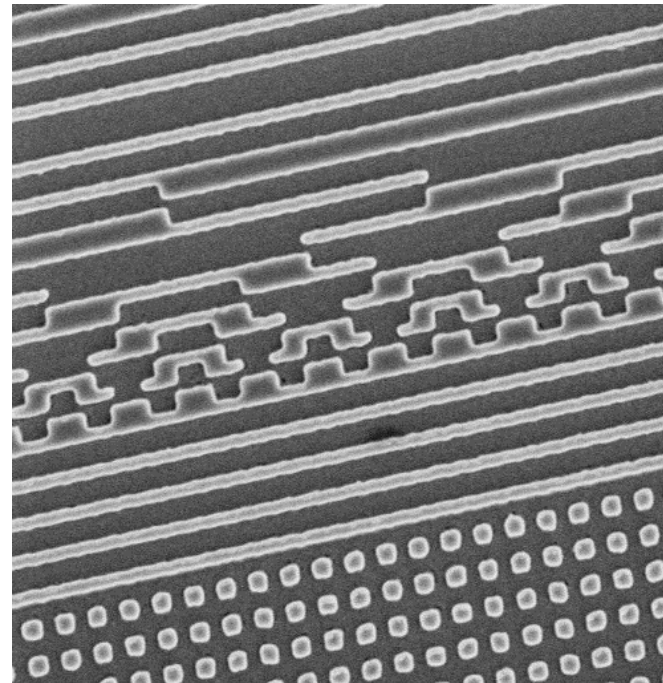


EBLITHOは、微細性と生産性を満たす完全周期ナノ構造をEpi基板に非接触で転写できます。

### ③製品ラインアップの充実

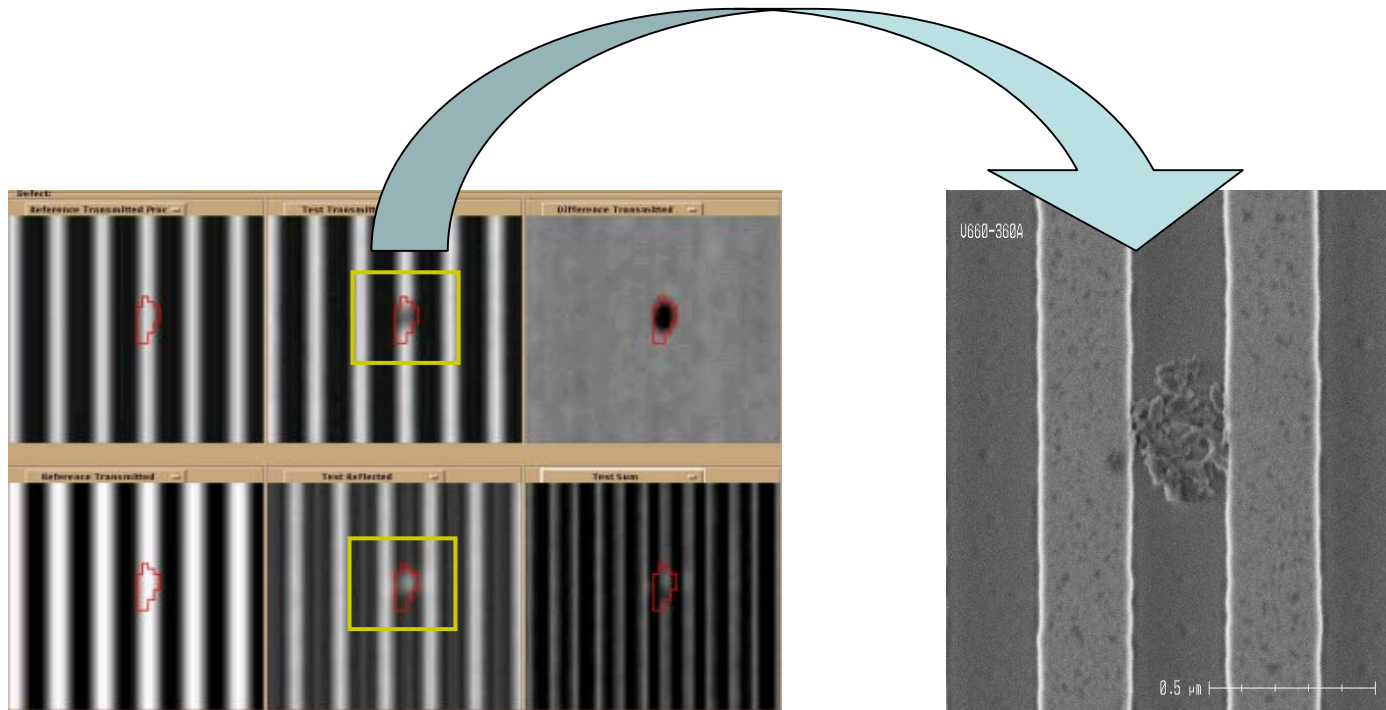
ホロン固有技術である絶縁物表面の高精度測定技術  
を応用して

- i. ナノインプリント超微細モールドの検査装置・測定装置の開発
- ii. ハードディスク・パターンドメディアの検査装置・測定装置の開発



これまでの光の検査では見えない領域へ

# 光学検査からSEM検査へ



光学検査装置の画像

CD-SEMの画像

# HOLONの技術

電子制御&  
位置合わせ技術

## LED/LD

発光効率アップ

生産性アップ

高分解能

Charge-free  
Contami-free

## 半導体

45nm

32nm

22nm

DUV Lithography  
Quartz Mask

EUV Mask

Nano-Imprint  
Quartz Mold

## Nano-Imprint

検査・測定

# HOLON

# 業績見通しの開示について

- 本資料に記載されている内容は、現時点で入手可能な情報に基づき予測したものであり、下記のリスク等や不確定要因等を含んだものであることをご了承願います。また、新たな情報、将来の事象、その他の結果に関わらず、常に株式会社ホロンが将来の見直しを見直すとは限りません。
- 当社の製品については国内販売については検収基準、海外については船積基準を原則として売上を計上しております。本資料における売上見込みは現時点での進捗見込みに基づくものであり、検収が遅れるリスクを含んでおります。
- また、当社を取り巻く経済情勢、株式市場動向等により、実際の業績等が経営目標その他の見通しと異なる結果となる可能性もあります。